im lithography; thin membranes for electro-n

tions; electrons. Process avoids clearage of H or F atoms or results in stabilisation due to removal of low mot, polymers, etc.; (f) have better chemical stability.

ABEQ EP 132686 B UPAB: 930925

A process for the production of ***plasma*** polymerized layers (on a substrate) form monomeric hydrocarbons and/or fluorocarbons by means of a high-frequency low-pressure glow discharge, characterised in that after its production, the "" plasma" polymer is subjected to an annealing step in the absence of air, in an atmosphere of hydrocarbon and/or fluorocarbon monomers at temperatures of between 100 and 450 deg. C for a period of 1 to 10

ABEQ US 5089290 A UPAB: 930925

Generation of polymer layers on substrate comprises (1) glow discharging monomers selected from hydrocarbons, fluorocarbons and mixes, of hydrocarbons and fluorocarbons at high frequency and low pressure to form polymer layers on substrates and (2) annealing the polymer layers in atmos, comprising at least one hydrocarbon and/or fluorocarbon monomer and in the absence of air at 100-450 deg.C for

ADVANTAGE - Method is provided for generating glow polymerisate layers in such a manner that chemically subic prods, are obid.

LS ANSWER 4 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD ACCESSION NUMBER: 82-7505E [15] WPIDS
TITLE: Porming smooth cost on substrate by

plasma* polymerisation of sikyl or

fluorosikyl (methacrylate onto substrate.

DERWENT CLASS: A14 A32 K05

PATENT ASSIGNEE(S): (DAIK) DAIKIN KOGYO KK COUNTRY COUNT:

PATENT INFORMATION:

PATENT NO KIND DATE WEEK LA PG

JP 57119905 A 820726 (8235)* JP 02011606 B 900315 (9015)

APPLICATION DETAILS:

PATENT NO KIND

APPLICATION DATE

JP 02011606 B

JP 81-6773 819119

PRIORITY APPLN. INFO: JP 81-6773 810119 AN 82-73505E [35] WPIDS

AN 22-73-935 [32] WILDS
AB JP57119906 A UPAB: 930915
Method comprises ***plasma*** polymerisation of alkylimetal)
acrylates or ***fluoroalkyl*** (meta)acrylates onto a substrate.
The process enables rather thick (30-100 microns) cost of high smoothness (0.1 microns) and of uniform thickness to be formed on the substrate rapidly (6 microns/hr.). The coat is useful as an ablator shell in a fuel puricle for nuclear fusion.

inert gas (e.g. argon or krypton) activated by glow discharge.

LS ANSWER 5 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 1997 DERWENT INFORMATION LTD ACCESSION NUMBER: \$2-33414E [17] WPIDS TITLE: Glow discharge polymerisation of

- (11) Patent Application No. 57-119906
- (12) Patent Application (A)
- (19) Japanese Patent Agency (JP)
- (43) Application published 26 July 1982
- (51) Int. Cl.³
 C 08 F 120/10
 C 08 F 2/52
 Identifier
 Internal classification
 7308-4 J
 7102-4 J
 Number of inventions: 1
 - Application for inspection: not applied for
 - (5 pages in total)
- (54) A method of forming smooth coatings on substrates
- (21) Application No. 56-6773
- (22) Date of filing: 19 January 1981
- (72) Inventor: Chiyoe YAMANAKA
- (72) Inventor: Masayuki IEDA
- (72) Inventor: Shintaro ISHIBASHI
- (72) Inventor: Shinjo MORITA
- (72) Inventor: Tsuneo FUJII
- (71) Applicants: Daikin Industries
- (74) Agents: Muneta ASAHINA Patent Attorneys

Specification

1. Description of invention

A method of forming smooth coatings on substrates.

2. Scope of patent application

A method of forming smooth coatings on substrates characterised by the fact that alkyl(meth)acrylate or fluoroalkyl(meth)acrylate are polymerised on substrates by plasma polymerisation.

3. Detailed explanation of invention

The invention relates to a method of forming smooth coatings on substrates. Specifically, it relates to a method of producing such coatings by plasma polymerisation.

Various methods of applying coatings to substrates are already known, including methods of forming such coatings by plasma polymerisation. Nevertheless, it is extremely difficult to produce smooth coatings, especially on non-planar substrates, such as textiles, spheres, cylinders and other intricately shaped substrates and a fairly long time was required to produce such coatings. In nuclear fusion, for example, there have recently been rapid developments in inertial-confinement fusion and in particular, nuclear fusion reactions are being achieved using laser radiation, electron beams and ion beams as energy drivers. In nuclear fusion small spheres containing deuterium and tritium fuel sealed in a glass and gold pusher (a spherical shell container) are bombarded with laser energy and compressed to ultrahigh densities of 10²⁶ ions/cm³, i.e., ten thousand times the solid fuel density of 10²² ions/cm³ and can reach temperatures of a billion degrees. The compression may be considered to be "ejection-type compression", as compared with explosive compression where the pusher is converted into plasma by the laser radiation and the compression uses the shock forces of the plasma. In the first case, the shell comprising the pusher encasing the fuel is made of a high-density material, the entire structure is heated uniformly within a short time by x-ray radiation and fast electrons produced by the laser energy, reducing its thickness, and it is doubtful whether ultrahigh density compression can be achieved since the increase in temperature is appreciable compared with the density. In the second case, the fuel shells have a thick layer of low-density material applied to the outside of the fuel and under laser irradiation the fuel is compressed by the rocket action of the plasma ejected outwards. Various designs of fuel shells have been developed on an experimental scale. Examples include vacuum-cored, solid fuel (solidifying at low temperatures) shells, high-Z shells, low-density shells, external pusher shells, and ablator shells and there are external pusher shells formed of layers of varying density. In high-Z shells, highly charged electrons are shielded by a heat shield layer and x-rays are absorbed whereas in low-density shells fast electrons are shielded electrostatically and when the ablator shell undergoes laser irradiation and is converted into plasma, the thermal effect on the fuel shell is reduced and an effective plasma compression effect can be achieved.

The ablator shells used here (low-Z shells) are produced by known methods of obtaining tetrafluoroethylene or trans-2-butene polymer coatings by plasma polymerisation. Since these ablator shells must be converted uniformly into plasma, they must have a uniform thickness of approximately 50-100 μ m with a surface smoothness of 0.1 μ m. In order to meet these requirements, the rate of formation of said polymer coatings must be less than 1 μ m/h. High-speed methods of forming coatings are known, such as a method of forming coatings which meet these requirements at a rate of approximately 5 μ m/h by thermal polymerisation of parylene. However, thermal polymerisation is not desirable because heating above 100°C must be avoided.

The aim of the present invention is to propose a method of producing smooth, comparatively thick coatings of uniform thickness which satisfy the afore-mentioned requirements and are formed by plasma polymerisation at a faster speed than those produced by conventional techniques.

The aforesaid aim is satisfied by plasma polymerisation of alkyl(meth)acrylate or fluoroalkyl(meth)acrylate on substrates. In this specification (meth)acrylate denotes either methacrylate or acrylate.

According to the invention an extremely smooth, comparatively thick coating of uniform thickness can be produced on a substrate in a short time. Specifically a coating having a uniform thickness of 30-100 μ m and a smoothness of 0.1 μ m can be produced at a rate of 6 μ m/h.

The alkyl(meth)acrylate used in the present invention should combine straight-chain, branched-chain or cyclic alkyl groups with 1-20 carbons and (meth)acrylate groups. The number of carbons in the alkyl groups should preferably be between 1 and 12, with between 1 and 6 being the most desirable. Examples of the alkyl(meth)acrylates used in the present invention include methylacrylate, ethylacrylate, n-butylacrylate, isobutylacrylate, dodecylacrylate, n-octylacrylate, 2-chlor-ethylacrylate, phenylacrylate, methyl α -chloracrylate, methylmethacrylate, ethylmethacrylate, butylmethacrylate and ethyl α -ethylacrylate.

The fluoroalkyl(meth)acrylate used in the present invention should contain (meth)acrylate groups and alkyl groups where the hydrogen has been partially or completely replaced by fluorine except for the hydrogen attached to carbons being links in straight-chain, branched-chain or cyclic alkyl groups containing 1-20 carbons. The number of carbons in the fluoroalkyl groups should preferably be 1-12 with 1-6 being the most preferable. An example of a fluoroalkyl(meth)acrylate used in the present invention is given by the formula:

where R_f is a straight-chain or branched-chain perfluoroalkyl group with 1-15 carbons or a group containing at least one fluorine atom and in which more than one fluorine atom has been replaced by a hydrogen atom, R^1 is a hydrogen atom or a methyl group and R^2 is a divalent hydrocarbon residue group. The number of carbon atoms in the R_f group is between 1 and 15 and preferably between 1 and 10, and the number of fluorine atoms should be at least one and preferably at least half the sum of carbon atoms in the R^2 group and the number of carbon atoms in the R_f group with the acrylate or methacrylate group, the number of carbon atoms should be between 1 and 10 and preferably between 1 and 5, although this is not critical.

Examples of fluoroalkyl (meth)acrylates used in the invention are given as follows:

$$\begin{aligned} & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CF}_2)_2 \text{H} \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_3)_2 (\text{CF}_2)_2 \text{H} \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_2 \text{CHFCF}_3 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_2 \text{CF}_2 \text{CHFCF}_3 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}(\text{CH}_3)\text{CF}_2 \text{CHFCF}_3 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{CF}_2 \text{CHFCF}_3 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}(\text{C}_3\text{H}_7)\text{CF}_2 \text{CHFCF}_3 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_3)_2 (\text{C}_2\text{H}_5)\text{CF}_2 \text{CHFCF}_3 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_3)_2 (\text{C}_2\text{H}_5)\text{CF}_2 \text{CHFCF}_3 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_3)_2 (\text{CF}_2\text{CF}_2)_n \text{H} \\ & n = 2, 3, 4, 5 \end{aligned}$$

$$& \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_3)_2 (\text{CF}_2\text{CF}_2)_n \text{H} \\ & n = 2, 3, 4, 5 \end{aligned}$$

$$& \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_3)_2 (\text{CF}_2\text{CF}_2)_n \text{CF}(\text{CF}_3)_2 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_3)_2 \text{CF}_2 \text{CH}(\text{CF}_3)_2 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOC}(\text{CH}_2\text{CF}_2\text{CF}_2)_n \text{CF}(\text{CF}_3)_2 \\ & \text{n} = 1 - 5 \end{aligned}$$

$$& \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_2 (\text{CF}_2\text{CF}_2)_n \text{CF}(\text{CF}_3)_2 \\ & \text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_2 \text{CH}_2 (\text{CF}_2\text{CF}_2)_n \text{F} \\ & \text{n} = 1 - 10 \end{aligned}$$

The boiling points of the alkyl(meth)acrylates or fluoroalkyl(meth)acrylates should preferably be below 400°C at atmospheric pressure or below 70°C at 40 Torr.

h god

The plasma polymerisation of alkyl(meth)acrylate or fluoroalkyl(meth)acrylate on a substrate is then carried out by placing the substrate in a stream of low-pressure gas mixture comprising alkyl(meth)acrylate or fluoroalkyl(meth)acrylate and a rare gas and exciting a glow discharge in the vicinity or by placing the substrate in a stream of low-pressure gas mixture comprising alkyl(meth)acrylate or fluoroalkyl(meth)acrylate and a rare gas after this has been excited by a glow discharge (afterglow method).

The rare gas can be helium, neon, argon, krypton or xenon with argon and krypton being preferable.

The glow discharge is ignited by positioning two parallel plate electrodes inside the reaction tube or by placing an induction coil outside the reaction tube and applying an rf voltage or an rf current. Whichever type of discharge is ignited and whether the substrate is positioned inside the discharge zone or the afterglow method is used, the temperature should be 0-200°C, the pressure should be between 10 and 10⁻⁴ Torr, and preferably between 1 and 10⁻² Torr, the rare gas flux should be between 0.1 and 100 cm³STP/min and the monomer flux, such as alkylacrylate should be between 0.5% and 50% of the rare gas flux and it is particularly desirable for this flux to be between 1% and 20%. The glow discharge should be initiated in an rf electric field at a frequency of 0.1-100 MHz and the discharge power should be between 1 and 500 W. The substrate may be spherical, flat or intricately shaped and should be made of solid materials such as metal, glass or textiles.

In the plasma polymerisation device the reaction tube should be heated so that polymer does not form on the walls of the tube and the electrodes should also be cooled as in the following example of embodiment.

In this plasma polymerisation method, after polymerisation has taken place for a fixed time, rare gas is passed through the reaction tube either by itself or together with the monomer, stopping the discharge at a fixed time. By thus preventing the formation of polymers in the gas phase, this is an effective method of maintaining a smooth surface.

By incorporating elements such as chlorine, bromine, gold, thallium, silver, and copper in the coatings as derivatives in a form where these elements have combined in the form of salts or complexes (metal elements) or replace part of the aforementioned monomers (chlorine or bromine), this can be used as a diagnostic technique for nuclear fusion. This can be observed as a result of the production of x-rays when plasma is formed by the laser irradiation. Other diagnostic techniques such as metal evaporation during plasma polymerisation can be carried out using metals such as gold and monomers containing chlorine or bromine such as p-chlorostyrene, vinyl chloride, p-chloroacrylanilide and vinylidenechloride can be specially introduced during plasma polymerisation.

Examples of embodiment of this method of forming coatings according to the invention are given, although the invention is not confined to these.

Example of Embodiment No. 1

Polymerisation was carried out using the plasma polymerisation device whose main components are shown in the diagram. The main components of this device in order from the end are an argon inlet, a monomer inlet, a polytetrafluoroethylene insert (1) positioned inside the device, electrodes (2) positioned internally, a polytetrafluoroethylene insert (3) positioned internally and a glass tube (4) having at the other end an outlet connected to a vacuum pump via a liquid nitrogen trap.

The electrodes comprise two parallel copper plates (15.4 cm long, 6.5 cm wide and 3.5 cm apart) positioned inside the aforesaid glass tube (8 cm internal diameter) with a thin glass tube 200 μ m in diameter positioned longitudinally on the centre line between the electrodes. The electrodes were water-cooled by forming a semicylindrical chamber such that water flows in the gap between the electrodes and the walls and not between the electrodes.

After the inside of the glass tube had reached a vacuum of 0.05 Torr, and argon was passed through at a rate of 2.8 cm³STP/min and at approximately 0.45 Torr, plasma polymerisation was carried out under the following conditions while the monomer was flowing

Electrode temperature	19°C
Argon flux	2.8 cm ³ STP/min
Monomer flux (2,2,3,4,4,4-hexafluorobutylmethacrylate)	0.3 cm ³ STP/min
Gas pressure	0.5 Torr

Discharge power	7 W
Discharge frequency	13.56 MHz

Discharge time 420 min

After the plasma polymerisation process, the thin glass tube was removed, and as a result of an electron microscope examination and metal evaporation (gold), it was found that a cylindrical polymer of 285 μm external diameter had formed around the thin glass tube at the centre. The external roughness was less than 0.1 μm and the coating rate was approximately 6 $\mu m/h$.

Example of Embodiment No. 2

As in the example of embodiment No. 1, plasma polymerisation was carried out with the substrate positioned at the centre of the electrodes as follows.

The substrate was a 200 μm glass sphere (Tokyo Shibaura Denki, BG705) araldited to the end of a thin glass tube having an external diameter of 70 μm . The glass sphere had a smooth surface of 285 μm external diameter formed by the polymer coating with a roughness of less than 0.1 μm and a uniform coating 40 μm thick had formed around the thin glass tube. The coating rate was approximately 6 $\mu m/h$.

Example of Embodiment No. 3

Apart from using methylmethacrylate as the monomer, the plasma polymerisation was carried out as in example of embodiment No. 1. A cylindrical polymer of 275 μ m external diameter formed around the thin glass tube. The external roughness was 0.1 μ m and the coating rate was approximately 5.5 μ m/h.

4. Detailed Explanation of Figures

The diagram shows a schematic of the main components of the plasma polymerisation device used in the method according to the invention.

Figure captions:

(1) and (3): polytetrafluoroethylene inserts

(2): electrodes

(4): glass tube.

Applicants: Daikin Industries

Agents: Muneta ASAHINA Patent Attorneys

(NB: the appended corrections have been incorporated in the text).

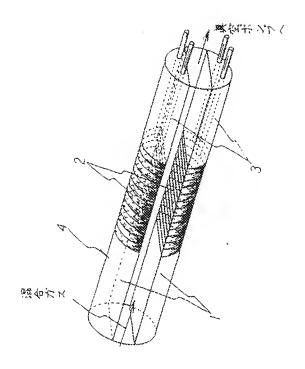
external diameter formed around the thin glass tube. The external roughness was 0.1 μm and the coating rate was approximately 5.5 $\mu m/h$.

4. Detailed Explanation of Figures

The diagram shows a schematic of the main components of the plasma polymerisation device used in the method according to the invention.

Figure captions:

- (1) and (3): polytetrafluoroethylene inserts
- (2): electrodes
- (4): glass tube.



Applicants: Daikin Industries

Agents: Muneta ASAHINA Patent Attorneys

(NB: the appended corrections have been incorporated in the text).

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭57-119906

①Int. Cl.³
C 08 F 120/10
#C 08 F 2/52

識別記号

庁内整理番号 7308—4 J 7102—4 J

◎公開 昭和57年(1982) 7月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全5頁)

◎基体上に平滑な被膜を形成する方法

②特 願 昭56-6773

②出 · 願昭56(1981)1月19日

切発 明 者 山中千代衛

芦屋市西山町23

⑩発 明 者 家田正之

名古屋市天白区天白町島田西寄

類918の2

⑩発 明 者 石橋新太郎

名古屋市昭和区滝子町21の8

⑩発 明 者 森田慎三

名古屋市天白区天白町平針神田

297

②発 明 者 藤井恒男

吹田市青山台1の3

の出 願 人 ダイキン工業株式会社

大阪市北区梅田1丁目12番39号

新阪急ビル

砂代 理 人 弁理士 朝日奈宗太

明 紹 審

1 発明の名称

蒸体上に平滑な被膜を形成する方法

2 特許額求の範囲

1

著体上でアルキル(メタ)アクリレートまたはフルオロアルキル(メタ)アクリレートをプラスマ競合することを特徴とする基体上
に平滑な被鰻を形成する方法。

5 発明の幹細な説明

本発明は、基体上に平滑を被要を形成する方法に関する。とくにブラズマ集合により形成する方法に関する。

従来、無体上に軽度を形成する方法は、強々知られており、ブラズマ露合により形成する方法を知られている。しかしながら、平滑な技族を形成することは、とくに平面でない基体、たとえば総総状や球状体や円柱状体その協複雑な

形の著体上に形成することは困難であり、また それを形成するのにかなり長時間を變するもの であった。たとえば、複数合では、近時、慢性 閉じ込め整軸台が展選に開発され、とくにレー ザー党鉄選子ビーム、イオンビームをエネルギ ードライバーとして用いる該顧台反応が緊迫さ れつつある。この複酸含では、デュウトリウム とトリチウムからなる機料をガラスや兪のブッ シャー(琼敷状の容器)に對じた小珠にレーゼ - 光線を周囲からあてて関係燃料密度10²²/オンかn³ の1万倍すなわち10²⁸Yオン6x2の最高密度に圧縮し て1億度の温度を遠成しようとするものである。 圧縮のためには、ブッシャーをレーザー光線に よりブラズマ化してとのブラズマの影響力を利 用する「爆発型の圧縮」に対し、「敷出型の圧 顧」が考えられている。前者では、魏粹を包む ブッシャーとなる殺を比重の大きな物質とし、 祭さを難くしてルーサー からのエネルギーを X線額對や腐選電子によって短時間に全体を一 機に顔熱するもので、密度より温度の上昇が響

しくなつて超离密崖の圧縮がおぼつかない。發 套では、鐵料の外側をさらに低密度の物質層で 摩く獲つた燃料小頭を用い、レーザー服動を加 えて、外方へ曠出するツラズマのロケット作用 で燃料を圧縮する。実験のスケールにつれて程 々の構造の燃料小環が開発されている。一例を 挙げると、中心から異恋、固体燃料(佐温にし て飯化されている)数、高原子養骨物質数、低 密度物質製、外部アツシャー製、アフレーター 髪からなり、外部ブツシャー数は檻々の密度の 層からなる。とれらのかち、高原子番号勢毀穀 は、熱滋断膜で大きな蟹荷で電子を遮断し、か つ×線綱射を吸収し、低密度物質數は、高速電 子を鬱魔気的に遊戲して、アプレーター設がレ 一ザー般射を受けてプラスマ化したとき、燃料 数への熱効果を低放し、ブラズマ化の圧縮効果 が効果的に伝送するということである。

ここに使用するアプレーター数(低原子背号 物質数)は、これまでプラズマ最合によりテト ラフルオロエチレンまたはトランス~2~ブテ

(3)

9 0

これによりをわめて平滑で厚さの一様な比較的厚い被膜を短時間で基体上に形成することができる。具体的には、0.14mの平滑度を有する厚さの一級な 50~1004mの被膜を 64m/hrで形成することができる。

本発明において用いるアルキル(メタ)アクリレートは、炭楽数 1 ~ 20個の 直毅状、分骸数状または深致のアルキル基と(メタ)ましな好ったものがよい。好ましが好きしたものがよい。好ましを好ったいかがより、ちのののののでででいる。本発明において用いるアルキル(メタ)アクリル酸エテル、アクリル酸コーオクチル、アクリル酸コーオクチル、アクリル酸コーオクチル、アクリル酸コーオクチル、アクリル酸コーオクチル、アクリル酸コーオクチル、アクリル酸コーオクチル、アクリル酸コーカチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸フテル、コーエテクリル酸エチル、メタクリル酸プチル、コーエテクリル酸エチル、メタクリル酸プチル、コー

ンの重合体被膜として形成する方法が知られている。このアプレーター般は、均一にアラスマ化される必要があるため、約50~180μmの一般な際さて表面の平滑度が 0.1μm のものが要求される。この要求に応じるため、前記重合被要の形成には、その形成速度を 1μm/hr以下としたければならないとされている。被膜形成速度が大きい方法としては、パリレンを熱重合して約5μm/hr の速度で前記要求に応ずる被膜を形成する方法が知られている。しかし 100 ℃以上の加熱は無じられるので、熱圧合は好ましくない。

本発明の目的は、前記要求に応ずる平滑で一様を厚さの比較的厚い被談をフラスマ重合により、従来より大きな形成滋度で形成する方法を提供することにある。

制記目的は、基体上でアルキル(メタ)アクリレートまたはフルオロアルキル(メタ)アクリレートをプラズマ取合することにより継載される。本明網論において(メタ)アクリレートをい

(4)

ルアクリル酸エチルなどである。

本発明において用いるフルオロアルキル(メタ)アクリレートは、炭素数:~20個の魔機状、分数級状または環状のアルキル帯において、結合学を有する炭素に結合する水素を除く水素が一部または全部フツ寒により置換されたアルキル巻と(メタ)アクリレート薬とが結合したものがよい。好ましくはフルオロアルキル基の炭素数が1~12個、もつとも好ましくはフルオロアルキル機の炭素数が1~6個のものである。本発明において用いるフルオロアルキル(メタ)アクリレートを例示すれば、式:

R.R. OCOOOR 1 --- OH 2

(式中、R_I性炭素数·1~15個の魔蝎状または分数数状のバーアルギロアルキル基またはこれのフツ楽原子: 個以上が水業原子によつて置換されかつ少なくともフツ素原子: 個を育する基、R¹は水業原子またはメチル基ねよびR²は2面の炭化水業機基を示す)

で示されるものがよい。Br並は、炭素原子数が

1~15個好ましくは1~10個であり、フツ紫原子数が少なくともり個、好ましくは、Rt 基の設 紫原子数との和の少なくとも1/2 である。R2 基は、アクリレート基またはメタクリレート基とRt 基とを運輸するためのものであり、その設業原子数は、1~10個をかんづく1~5個が好ましいが、際界的なものではない。

本発明において用いられるフルオロアルキル (メタ)アクリレートをさらに異体的に例示すると、

遊体をおく(アフォーグロー法)がすることにより行なり。

不指性ガスには、ヘリウム、ネオン、アルコン、クリプトン、キセノンを使用することができ、好ましくは、アルコンおよびクリプトンである。

 ${\rm or}_{\rm g} = 0 \, ({\rm or}_{\rm S}) \, {\rm occo} \, ({\rm or}_{\rm S})_{\rm g} ({\rm or}_{\rm S} {\rm or}_{\rm g})_{\rm H}$

 $0H_2 - 0(GH_3)0000(GH_3)_g OF_g OH(GF_3)_g$

 $a_{15} - a_{15} = a$

OH2-O(OH3)OOOGH2OH2(OF2)EF

である。

また、好きしいアルキル(メタ)アクリレートまたはフルオロアルキル(メタ)アクリレートは、節点が大気圧で 400 m 以下または407orrで 76 o以下のものである。

しかして、基体上でアルキル(メタ)アクリレートまたはフルオロアルキル(メタ)アクリレートをプラズマ割合するには、アルキル(メタ)アクリレートをできるには、アルキル(メタ)アクリレートと不活性気体との優強でグロー版をの気流中に基体を置いてその優強でグロー版をの気流中に基体を関いてアルキル(メタ)アクリレートとの低圧混合気体の気流中に

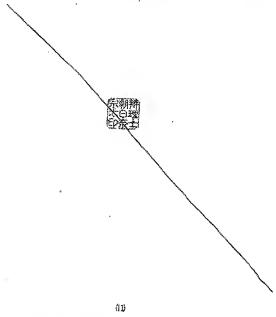
(ñ)

問わず、その材質は金属、ガラス、樹脂など闘体であればよい。

プラズマ 数合設 選 については、反応管は管盤 に 数合体が形成されないようにするため冷却す ることも好ましく、監磁も後述の実施例で示す ように冷知するのが好ましい。

またアラズマ暴合方法として、一定時間重合したのち、一定時間放覧をとめて不活性ガスだけまたはモノマーとともに反応管内を祝澄させて、気相で重合体の形成を防止するのが形成登断の平滑性を保つために有効な方法である。

また複楽、シュウ楽、金、タリウム、銀、網 などで前記モノマーの一部を置換(塩素または シュウ素のばあい)またはこれらの元素を結合 した形(金製元素のばあい、塩または離体の形) の誘導体として被談にこれらの元素を入れて、 総数合時のダイアグノシスの手段とすることが できる。このばあいには、レーザー光線によるア ラズマ化時の×線の発生により観察することが できる。ダイアグノシスのためには、このほか 金などの金属では、金属器 簡をプラズマ類合間 化行なりなどの手段があり、また別途ロータロ ロスチレン、塩化ビニル、ロークロロアクリル アニリド、ビニリデンクロライドなどの塩業ま たはシュウ業を含有するモノマーをプラズマ盤 合して入れることもできる。



ガラス質内を実理 (0.05 Torr)に引き、アルゴンを2.8 on * STF/min および約0.45 Torrで流しさらにモノマーを流しなから、つぎの条件でプラスマ載合を行なつた。

電極温度	19 %
アルマン流量	2.8cm 5sTP/min
モノマー (2,2,3,4,4,4 - ヘチサフル	
オロブチルメタクリレート)流量	G.Jon ³ STP/min
# Z E	0.5Torr
放 電 電 力	フワット
汝 鹭 腐 波 数	13.56 MH s
放電時間	420min
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	

ブラズマ藍合後ガラス都管を取り出し、金属蒸落(金)して電子顕微鏡で観察した結果、ガラス翻管の中央では、外径 285μm の円筒状の重合体がガラス翻管を中心に形成されていた。外 筒の凹凸は 0.1μm 以下であり、被獲額度は約6μm/arであつた。

赛路例 2

実施例1と同様にして、つぎに示す菸体を掘

つぎに本発明の 被膜形成方法の実施例を示すが、本発明はそれらのみに限定されるものではない。

爽筋例1

その主要部を図面に示すプラズマ第合装置を用いて置合を行なつた。 数数額は、一端から 類に アルゴン供給口、モノマー 鉄 給口、内部に 数置した ポリテトラフルオロエチレン 製締入体(1)、内部に 数置した 寒傷(3)、内部に 数置した ボリテトラフルオロエチレン 製挿入体(3)、他 端に 液体 20 窓 トラップを 適つて 変空 ポンプにつな がる 排 気口を 鍛えつけた ガラス管(4)を主 製船とする ものである。

電磁は、2枚の動製平行平板電橋(長さ15.40m、総 6.50m、開闢 3.5cm)であり、これを削配が
ラス質(内径 8cm)内に削配のとわり 散 難し、 魔径 200月m のガラス細管を電機関空間の長さ方 肉の中心線に設置した。 電極は、それぞれ極関 でないガラス管臓とでなす空間に水を通せるよ 5にカマボコ型指をなして、水により冷却した。

02

間の中央においてブラスマ第合を行なった。 基体としては、280mのグラス球(東京保護

会社額、03705)を外径70μmのガラス細管の光端にアラルダイトで接着したものを用いた。ガラス殊には、重合体の被談が形成された直径285μmの設面が平滑で担凸が0.1μm以下の身が形成され、ガラス細管の周囲に厚さ40μmの一度な被談が形成されていた。被覆差異は約6μm/nrであつた。

繁 無 劉 玄

モノマーとしてメチルメキクリレートを用いたほかは実施第1と同様にして、プラズマ重音を行なつた。外径 275μm の円筒状の重音体がガラス 初蟹を中心に形成されていた。外側の凹凸は 0.1μm 以下であり、被機速度は約5.5μm/hrであつた。

4 図面の簡単な説明・

図面は本発明の方法に用いるアラス * 薫合装 像の主要係の機略図である。

(図面の符号の説明)

- (1)、(3):ポリテトラフルオロエチレン製作人体
 - (2): 篦 極
 - (4): ガラス管

等新出版人 ダイキン工業株式会社 代題人 弁選士 朝 日 奈 宗 太宗領院 FOGE

(in

手統補正 暫(自発)

照和 8 6 年 6 **1**0 1

特許庁長官 岛 田 寮 権 監

- 1 事件の表示 昭和 56 年特許顯第 6778 旁
- 2 発明の名称 薬体上に平滑な被膜を形成する方法
- 3 補正をする者 事件との関係 特 許 出 顯 人

住所 大阪市北区梅田1丁目12巻39号 (286) ダイキン工 線株式 (286) ダイキン工 線株式 (386) ダイキン工 線株式 (386) (488) 山田 (488) 山田 (488) 山田 (488) 山田 (488)

4 代 塑 人 〒540

任 所 大阪市東区京橋 8 丁目60番地 北川ビル 原列務 氏 名 (6522) 弁理士 朝 日 京 宗 本人の理 電 版 (05) 943 — 8 9 2 2 (代) ビア企士

5 裕正の対象

(1) 明細盤の「発明の野網な説明」の個

6 雑正の内容

- (1) 明細語の7頁を行の「原子数との和」を 「原子数とH² 数の炭素原子数の和」と補正す さ。
- (2) 同 8 裏下から4 行の「その簡頤で」を「その問題でグロー放電するか、または」と補正する。
- (a) 同10頁4行の「冷却」を「加熱」と補正する。
- (4) 関18 翼 5 行の「電概も」を「電極は」と線 正する。
- (8) 例 10 页 10 行の「冤棍で載合体」を「気相 での悪合体」と補正する。

以上